

(43) 国際公開日
2007 年 4 月 12 日 (12.04.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/039985 A1

- (51) 国際特許分類:
C04B 41/85 (2006.01) *B01J 37/02* (2006.01)
B01J 33/00 (2006.01) *B01J 37/08* (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01) *C04B 41/89* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/315879
- (22) 国際出願日: 2006 年 8 月 10 日 (10.08.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
 特願2005-287644 2005 年 9 月 30 日 (30.09.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057117 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀内 伸彦 (HORI-UCHI, Nobuhiko) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 鍋

田 貴司 (NABETA, Takashi) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 宮添 智 (MIYAZOE, Satoru) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 水津 宏 (SUIZU, Hiroshi) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 野浪 亨 (NONAMI, Toru) [JP/JP]; 〒4700348 愛知県豊田市貝津町床立 1 0 1 Aichi (JP).

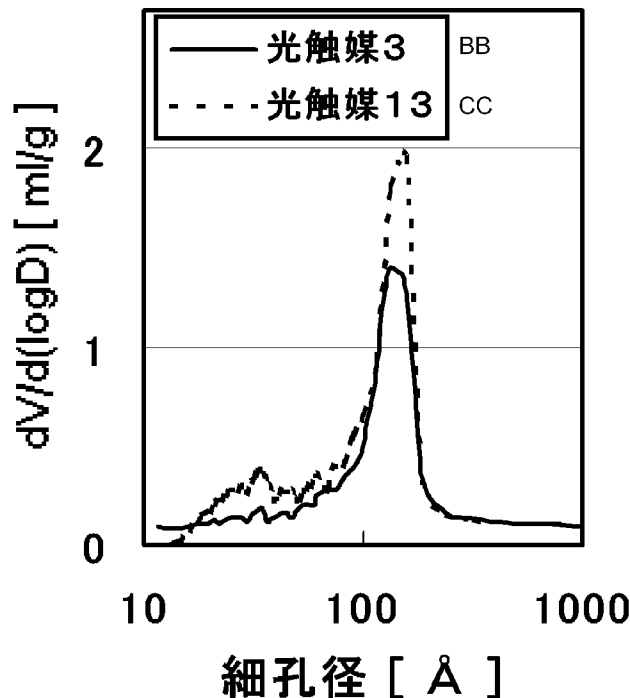
(74) 代理人: 速水 進治, 外 (HAYAMI, Shinji et al.); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 2 - 1 7 - 1 6 代官山 TKビル 1 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,

[続葉有]

(54) Title: INORGANIC SINTERED MATERIAL CONTAINING PHOTOCATALYST COVERED WITH SILICON OXIDE FILM

(54) 発明の名称: 酸化珪素膜で被覆された光触媒を含有する無機焼結体



AA... PORE DIAM. [Å]
 BB... PHOTOCATALYST 3
 CC... PHOTOCATALYST 13

(57) Abstract: An inorganic sintered material that excels in photocatalytic activity as compared with that exhibited in the use of a photocatalyst of titanium oxide only. There is produced an inorganic sintered material having on its surface a photocatalyst composed of a substratum having photocatalytic activity and, covering the substratum, a substantially nonporous silicon oxide film wherein the content of alkali metals is in the range of 1 to 1000 ppm.

(57) 要約: 酸化チタンのみの光触媒を使用した場合と比較し光触媒活性に優れる無機焼結体を提供すること。無機焼結体に、光触媒活性を有する基体と、該基体を被覆する、実質的に細孔を有しない酸化珪素膜とを有し、アルカリ金属含有量が 1 ppm 以上 1000 ppm 以下である、光触媒を表面に有する無機焼結体を製造する。



PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。